

Antihaft- und Selbstreinigungseffekt durch NanoSphere

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitrex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa**

Band (Jahr): **109 (2002)**

Heft 1

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-677359>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Antihaft- und Selbstreinigungseffekt durch NanoSphere®

Der natürliche Antihaft- und Selbstreinigungseffekt der neuen NanoSphere®-Imprägnierung von Schoeller hat auch die Textildesign-Jury des «Design Preis Schweiz 2001» überzeugt. Am 2. November wurde Schoeller Switzerland in Langenthal für die zukunftsweisende Entwicklung auf Basis der Nanotechnologie ausgezeichnet.

Die Funktion des neuen Wasser und Schmutz abweisenden Ausrüstungsverfahrens ist vergleichbar mit Phänomenen aus der Natur: Bestimmte Pflanzenblätter, Käferpanzer und Insektenflügel bleiben immer sauber, weil Schmutzteilchen auf ihrer rauhen und strukturierten Oberfläche so schlecht haften, dass schon leichter Regen genügt, um sie fortzuspülen. Dieses Prinzip wird durch die NanoSphere®-Technologie auf Textilien übertragen, indem eine spezielle, dreidimensionale Oberflächenstruktur angelegt wird. Aufgrund der geringen Berührungsfläche finden Schmutzpartikel keine Haftung. Sie bleiben an einem Wassertropfen hängen und werden einfach mitgerissen, sobald das Wasser abperlt.

Völlig neue Eigenschaften

«Die mikroskopisch kleine Dimension der Nanotechnologie erlaubt solche Oberflächenveränderungen und wird im Textilbereich ganz generell zu völlig neuen Eigenschaften führen», so Hans-Jürgen Hübner, CEO von Schoeller. «Wir stehen mit dieser Neuheit und Nachfolgeprodukten auf Nanoebene am Anfang einer fas-

zinierenden neuen Ära.» Das mit einer Anerkennung ausgezeichnete, innovative und effiziente Verfahren ist umweltfreundlich und regeneriert sich ausserdem praktisch selbstständig. Es wurde in der Schweiz unter Vorgabe des bluesign®-Standards entwickelt und von Schoeller in die Praxis umgesetzt. Schoeller-Textillien mit NanoSphere®-Ausrüstung sind seit Anfang 2001 erhältlich.



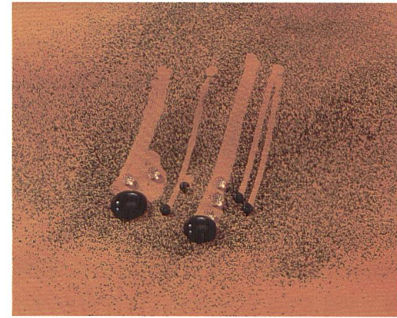
Von der Natur – für die Natur: Bestimmte Pflanzenblätter oder Insektenflügel bleiben immer sauber, weil Schmutz auf ihrer strukturierten Oberfläche nicht haften kann.

Aussergewöhnliche Designideen

Der im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschriebene Design Preis Schweiz würdigt aussergewöhnliche Designideen in den Kategorien Industrial Design, Textile Design, Interaction Design, Service Design, und vergibt den Willy Guhl-Nachwuchspreis sowie einen Verdienstpreis an eine Person oder Institution, die sich um die Förderung des Designs in der Schweiz verdient gemacht hat. Die aus sechs internationalen Design-Fachleuten zusammengesetzte Jury, hatten in diesem Jahr über insgesamt 534 eingereichte Objekte aus 20 Ländern zu entscheiden. Es wurden im Ganzen acht Preisträger und ein Verdienstträger ermittelt sowie 68 Anerkennungen ausgesprochen. Nach 1997 und 1999 wurde die Innovationskraft des Schweizer Textiltechnologieunternehmens in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge gewürdigt.



Der natürliche Antihaft- und Selbstreinigungseffekt der neuen NanoSphere®-Imprägnierung von Schoeller



Dieses effiziente und umweltfreundliche Funktionsprinzip wird von Schoeller mittels moderner Nanotechnologie auf Textiloberflächen übertragen.

Trademarks: NanoSphere® - Schoeller Textil AG

Uster® Statistics 2001

Anlässlich der ITMA ASIA in Singapore wurden die neuen USTER® STATISTICS 2001 der Fachwelt vorgestellt. Diese statistische Übersicht enthält Klassifikationsdaten für Fasern, Faserbänder, Vorgarne und Garne. Der Anwendungsbereich wurde um Informationen über Fasereigenschaften, wie Reifegrad, Faserfeinheit und Anteil an unreifen Fasern, sowie über Garnereigenschaften, wie Garndurchmesser, Querschnittsform, Garndichte, sowie Anzahl Staub- und Trashpartikel erweitert. Weiterhin wurde neu zwischen Strick- und Webgarnen unterschieden. Die USTER® STATISTICS 2001 stehen entweder auf CD zur Verfügung oder können auf der Website der Firma, <http://www.uster.com> abgerufen werden.

